

# 研究開発用スパッタ装置における業界トップランナー

A Top Runner in R&D sputtering equipment

## 研究開発用スパッタリング装置 CFS-4EP-LL<!--Miller>

R&D Sputtering Equipment

### お客様のメリット ~Merit For Customer~

Point <b>1</b>	Point <b>2</b>	Point <b>3</b>
<b>豊富な納入実績</b>	<b>全自動運転</b>	<b>多彩なオプション</b>
Many Delivered Result	Full Auto operation	Versatile options

### 商品・サービス特性 ~Features~

- 豊富な納入実績** *Many Delivered Result*  
 大学、研究機関、各企業に多数納入し、最先端の研究分野で活躍しています  
 We deliver a large number of products to universities, research institutes, companies and are active in the most advanced research fields
- 全自動運転** *Full Auto operation*  
 レシピ設定を行うことにより、全自動運転が可能  
 Recipe settings allow fully automatic operation
- 多彩なオプション** *Versatile options*  
 自動搬送機、ターゲット-基板間距離自動可変、同時スパッタ、バイアスパッタなどを用意  
 Automation system, Automatic variable distance between Target and Substrate, Co-sputtering, Bias sputtering, etc. are available

#### ●仕様● Specification

項目 Item	標準仕様 Standard specification	オプション Option
処理方法 System	ロードロック式 Load lock	
スパッタ方式 Sputter method	サイド Side	
同時スパッタ Co-sputter	無し None	可 (電源追加要) Available (Additional power supply)
バイアスパッタ Bias sputter	無し None	可 (電源追加要) Available (Additional power supply)
テーブル Table size	φ236mm 公転テーブル (有効エリア: φ220mm) φ236mm Rotation table (Valid area: φ220mm)	
スパッタ源 Cathode	φ3インチ×4 φ3inch×4	
電源 Power supply	RF 500W×1	DC、RF電源追加可能 DC and RF power supplies can be added
テーブル温調 Temperature control	Max 300°C加熱 Heating 300°C	Max 600°C加熱/水冷 Heating 600°C/Water cooling
ターゲット-基板間距離可変 Automatic variable distance between target and substrate	固定 Fix	自動可変 Automatic variable
主ポンプ Main pump	ターボポンプ 4インチ Turbo pump 4inch	ターボポンプ 8インチ Turbo pump 8inch
粗引きポンプ Roughing pump	ロータリーポンプ Oil rotary pump	ドライポンプ Dry pump
自動搬送機 Automation	無し None	有り With

#### ●外観● Over View



CFS-4EP-LL<!--Miller>



自動搬送機付